KEK 入射部用カットディスク型 RF ディフレクターの設計 DESIGN OF CUT DISC STRUCTURE TYPE RF-DEFLECTOR FOR KEK-LINAC

井上彬^{#, A)},夏井拓也 ^{A,B)},吉田光宏 ^{A,B)} Inoue Akira ^{#, A)}, Natsui Takuya^{A,B)}, Yoshida Mitsuhiro^{A,B)} ^{A)} SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies) ^{B)} High Energy Accelerator Research Organization (KEK)

Abstract

The luminosity for SuperKEKB at KEK is 8×10³⁵ cm⁻²s⁻¹, which is 40 times higher than that of KEKB. In order to realize this high luminosity, electron beams with a high charge of 5 nC and low emittances of 20 mm-mrad are required. Also, a bunch length is desired to be about 20 ps to avoid space charge effect when electron energy is low. To meet these requirements, we have developed a new type RF gun. To measure this bunch length, we will use a new type RF-deflector which has the cut disk structure for larger coupling effect between cells than that of conventional RF-deflector. We will plan to measure the bunch length with this RF-deflector at the downstream of RF gun. The operating frequency of the RF-deflector is 2856 MHz, and the electron energy at measuring point is 10 MeV. The simulation of electromagnetic field in the cavity with CST studio suite has already been completed, and this RF deflecting cavity is being produced.

1. はじめに

現在、高エネルギー加速器研究機構(KEK)では次世代電子陽電子衝突加速器 SuperKEKB の開発を進めている。SuperKEKB では 8×10³⁵ cm²s⁻¹という従来のKEKB の 40 倍のルミノシティを目標とした高性能化を計画しており、そのために多くの革新的な試みが為されている。その一つとして、我々のグループでは電子陽電子入射器において、電子源となる電子銃のアップグレードを行っている。SuperKEKB において高いルミノシティを得るため、電子陽電子入射器では高電荷化と低エミッタンス化が要求される。

Table 1: The Required Injection Beam Parameters [1]

	KEKB (e+/e-)	SuperKEKB (e+/e-)
Charge [nC]	1/1	4/5
Emittance [mm-mrad]	2100 / 300	10 / 20

このため、電子陽電子入射器の最上流にあたる電子銃も高電荷低エミッタンス化が要請され、従来の熱カソード DC 電子銃に代わるレーザーフォトカソード RF 電子銃の開発を進めている。[1]この電子銃開発では、大幅な性能向上を目標としているため、詳細な性能評価が必要となる。この電子銃開発では、大幅な性能向上を目標としているため、詳細な性能評価が必要となる。電子銃を出た直後のビームはエネルギーが 10MeV 程度と低いため、空間電荷効果の影響が大きく、エミッタンス悪化する。この問題を防ぐため、電子銃内部ではバンチ長が20psから30psとなるようにしている。一方、リニアックではウェイク場によるエミッタンス悪化を防ぐため、シケインで

バンチ圧縮をかけて10ps以下としている。低エミッタンスビームを得るためにバンチ長を細かく操作する必要があり、そのためにはバンチ長の測定が不可欠である。今までは、シケインの下流にてストリークカメラを用いてバンチ長を測定していたが、電子銃の直後の加速されていないビームのバンチ長も測定したい。そこで測定用に新しくRFディフレクターを開発している。

RF ディフレクターはダイポールモードの電磁場を用い た共振空洞であり、ビーム軸上に電場がなく、ビームの 進行方向に垂直な高周波の磁場が発生する。この磁場 により掃引されたビームをスクリーンに投影することで、 バンチ長を測定することができる。この方法はストリークカ メラの原理と似たものであるが、次の2点でストリークカメ ラよりも優れている。①ストリークカメラは、スクリーン上の 発光を光電極に取り込み、生成した電子ビームを進行方 向に垂直なパルス電場で掃引して測定している。そのた め、二重に空間電荷効果の影響を受けることになる。一 方、RF ディフレクターを用いた測定方法ではビームをダ イレクトに掃引して測定できるため、空間電荷効果の影 響を抑えることができる点で有利である。②ストリークカメ ラの掃引周波数は最大でも数 10MHz 程度であり、GHz 帯で動作する RF ディフレクターの方が時間分解能にお いても有利である。

測定は KEK 入射器の A1 セクターの 90° 入射ライン に設置した RF 電子銃の下流で行う。この地点におけるビームエネルギーはおよそ 10MeV である。

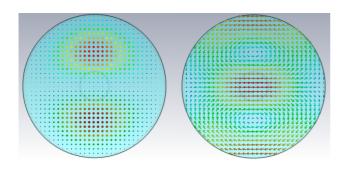
本稿では製作中のカットディスク型 RF ディフレクター の設計、および今後の予定について報告する。

2. RF ディフレクター

前節で述べたとおり、RF ディフレクターは TM11 モード(ダイポールモード、Figure 1)の電磁波を溜める共振空洞である。

[#] ainoue@post.kek.jp

PASJ2016 TUP083



(a) Electric Field

Field (b) Magnetic Field Figure 1: TM₁₁ mode.

RF ディフレクターを通るビームは Figure 2 のように掃引される。

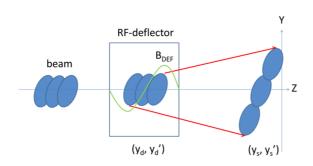


Figure 2: RF-Deflector.

キック角 $\Delta y'(\ll 1)$ はディフレクターによって与えられるy方向の運動量と進行方向の運動量の比で表される。

$$\Delta y' = \frac{el_d B_0}{p_z} \sin(kz + \varphi)$$

$$\approx \frac{el_d B_0}{p_z} \left(\frac{2\pi}{\lambda} z \cos \varphi + \sin \varphi\right) \tag{1}$$

$$\left(|z| \ll \frac{1}{\lambda} = \frac{\lambda}{2\pi}\right)$$

ここで

 l_d : ディフレクター長 B_0 : 最大磁束密度

 p_z : 進行方向の運動量 φ : ディフレクターの位相 ディフレクターからスクリーンまでの輸送行列は

イフレクターからスクリーンまでの輸送行列に
$$\begin{pmatrix} y_s \\ y'_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_d \\ y'_d + \Delta y' \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} m_{11}y_d + m_{12}\Delta y' \\ m_{21}y_d + m_{22}\Delta y' \end{pmatrix} \qquad (2)$$
$$(y'_d \ll \Delta y')$$

であるから、

$$\Delta y = m_{12} \Delta y'$$

$$= \sqrt{\beta_d \beta_s} \sin \psi \frac{e l_d B_0}{p_z} \left(\frac{2\pi}{\lambda} z \cos \varphi + \sin \varphi \right)$$
 (3)

ただし、 β_d はディフレクターにおけるベータ関数、 β_s はスクリーンにおけるベータ関数、 ψ はベータトロン振動の位相の進み。

バンチの中心が RF のゼロ交差を通るとき、 $\varphi = 0$ だから

$$\Delta y = \sqrt{\beta_d \beta_s} \sin \psi \frac{2\pi e l_d B_0}{\lambda p_z} z \tag{4}$$

ここで、S/N比はディフレクターなしの状態におけるスクリーン上のビームサイズ $\sigma_{y_0} = \sqrt{\beta_s \varepsilon_y}$ で定義され、

$$S/N := \frac{\Delta y}{\sigma_{y_0}} = \frac{\sqrt{\beta_d \beta_s} \sin \psi \frac{2\pi e l_d B_0}{\lambda p_z} \sigma_z}{\sqrt{\beta_s \varepsilon_y}} = \frac{\sqrt{\frac{\beta_d}{\varepsilon_y}} \sin \psi \frac{2\pi e l_d B_0}{\lambda p_z} \sigma_z}{\sqrt{\varepsilon_y}}$$
(5)

と表される。ただし σ_z は半バンチ長。式(5)より、SNN比は β_a に依存し β_s に無関係である。電子銃近くでは β_a が大きいため、RF ディフレクターによる測定が有効である。また、式(4)よりスクリーン上に映る影の長さはバンチ長に比例する。このことを利用してバンチ長を測定することができる。

3. 空洞設計

3.1 カットディスク構造

カットディスク構造は 1997 年に INR RAS でライナック 用の加速空洞として考案されたものである[2]。 Figure 3 のように共振空洞セルの間に結合用の薄いセルが挿入され、結合孔が空いた形状になっている。

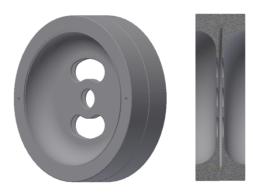


Figure 3: A cavity with cut disc structure.

カットディスク構造の特徴はセル間の結合度を大きくしやすいことである。セル間の結合度は隣接するセルが位相差 π を持つ π モードと同じ位相を持つ0モードのエネルギーの比で表され、周波数から以下の式で求められる。 [3]

$$k = \frac{f_{\pi}^2 - f_0^2}{f_{\pi}^2 + f_0^2}$$
 (6)

この式から結合度は 0 モードとπモードの周波数の差を表しており、結合度が大きいほどモードの切り分けがしやすくなる。

今回製作しているキャビティの CST MW STUDIO によるシミュレーション結果を Figure 4 に示す。

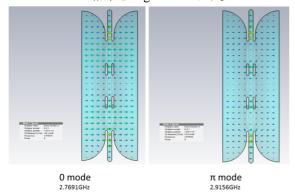


Figure 4: Electric field simulation of 0 mode and π mode with cut disc structure

このとき結合度はおよそ5%である。

3.2 セル数

今回の測定では、スクリーンを RF ディフレクターの下流 1m に設置する。RF ディフレクター内部のビームホール径が 20mm なので、 β は最大で 8.5 である。また、今回の実験では RF 源に最大出力 80kW の S-band サブブースター(2856MHz)を使用する。また、測定可能なバンチ長は 10ps 以上としたい。この条件でセル数を 1 から 13 まで変化させて電磁場シミュレーションを行って求めたビーム軸上の最大磁束密度用いて、式(5)より S/Nを計算した。

Table 2: Simulation of S/N

Tuble 2: Simulation of S/11				
Cells	RF-deflector	peak magnetic flux	S/N	
	length [mm]	density on axis[mT]	2/11	
1	44.3	35.41	4.224	
3	149.3	18.92	7.608	
5	254.3	15.29	10.47	
7	359.3	12.79	12.38	
9	464.3	11.29	14.12	
11	569.3	10.18	15.60	
13	674.3	9.31	16.9	

今回の測定で使用するビームラインでは、ビームダクト径が25mmしかなく、スクリーンにおけるビーム径を2mmほどに絞って測定するため、S/N は 10 程度あれば十分である。そのため、今回製作する RF ディフレクターのセル数は5に決定した。

3.3 電磁場シミュレーション

設計した空洞の電磁場シミュレーション結果をまとめる。 シミュレーションは CST MW STUDIO の Eigenmode Solver と Frequency domain solver を用いて行った。S パラメータから、 Q_L 値は8841であり、結合度 β は1.5であった。次式[3]から

$$\frac{1}{Q_L} = \frac{1}{Q_0} + \frac{1}{Q_{ext}} \tag{7}$$

$$\beta = \frac{Q_0}{Q_{ext}} \tag{8}$$

Q₀ は 22100、Q_{ext} は 14730 であった。

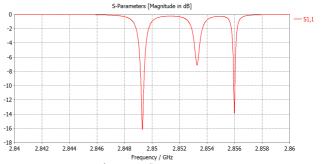


Figure 5: S-Parameter.

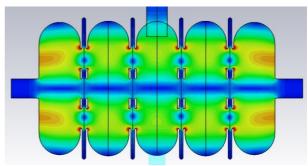


Figure 6: Electric field (abs).

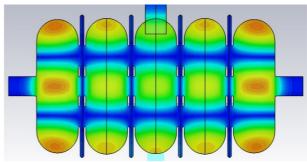


Figure 7: Magnetic field (abs).

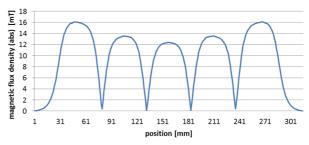


Figure 8: Plot of magnetic field (abs).

• 3.4 仕様まとめ

今回制作するディフレクターの仕様を一覧にする。最大磁束密度の値が Table 2 のものと異なるのは、第3 セ

PASJ2016 TUP083

ルに取り付けたカプラーと真空ポートの影響である。

Table 3: The Specification of RF-deflector

material pure cupper frequency 2856 MHz mode TM ₁₁₀ wave type standing wave number of cell 5 peak magnetic flux density on axis 13.53 mT (2nd cell and 5th cell) 12.39 mT (3rd cell) (if input power is 80 kW) loaded Q 8841 external Q 14730 unloaded Q 22100 coupling factor 1.5 structure cut disc structure length 254.3 mm radius of deflecting cells 69.93 mm (3rd cell) thickness of deflecting cells 73.78 mm cells 73.78 mm coupling cells beam hole diameter coupling hole size 983.2 mm²		defined for Ri defice to
mode wave type number of cell peak magnetic flux density on axis loaded Q external Q unloaded Q coupling factor structure length radius of deflecting cells radius of coupling cells radius of coupling cells thickness of coupling cells beam hole diameter rumber of cell standing wave 16.09 mT (1st cell and 5th cell) 13.53 mT (2nd cell and 4th cell) 12.39 mT (3rd cell) (if input power is 80 kW) 14730 22100 coupling factor 1.5 structure cut disc structure length rough (1st cell and 5th cell) 70.31 mm (2nd cell and 4th cell) 69.93 mm (3rd cell) 44.3 mm	material	pure cupper
wave type number of cell peak magnetic flux density on axis loaded Q external Q unloaded Q coupling factor structure length radius of deflecting cells radius of coupling cells radius of coupling cells thickness of deflecting cells thickness of coupling cells beam hole diameter standing wave 16.09 mT (1st cell and 5th cell) 12.39 mT (3rd cell) (if input power is 80 kW) 12.39 mT (3rd cell) 12.39 mT (3rd cell and 5th cell) 12.39 mT (1st cell and 5th cell) 12.39 mT (2nd cell and 5th cell) 12.39 mT (2nd cell and 4th cell) 12.39 mT (3rd cell and 5th cell) 12.39 mT (3rd cell) 12.39 mT (3rd cell) 12.39 mT (3rd cell) 12.39 mT (3rd cell and 5th cell) 12.39 mT (3rd cell) 12.30 mT (3rd cel	frequency	2856 MHz
number of cell peak magnetic flux density on axis loaded Q loaded	mode	TM_{110}
peak magnetic flux density on axis 16.09 mT (1st cell and 5th cell) 13.53 mT (2nd cell and 4th cell) 12.39 mT (3rd cell) (if input power is 80 kW) loaded Q external Q unloaded Q coupling factor structure length radius of deflecting cells thickness of deflecting cells thickness of coupling cells thickness of coupling cells beam hole diameter 20 mm 1.50	wave type	standing wave
density on axis 13.53 mT (2nd cell and 4th cell) 12.39 mT (3rd cell) (if input power is 80 kW) loaded Q external Q unloaded Q coupling factor structure length radius of deflecting cells thickness of deflecting cells radius of coupling cells thickness of coupling cells beam hole diameter 13.53 mT (2nd cell and 4th cell) 12.39 mT (3rd cell) 14730 22100 coupling factor 1.5 structure cut disc structure 254.3 mm (1st cell and 5th cell) 70.31 mm (2nd cell and 4th cell) 69.93 mm (3rd cell) 44.3 mm	number of cell	5
12.39 mT (3rd cell) (if input power is 80 kW) loaded Q 8841 external Q 14730 unloaded Q 22100 coupling factor 1.5 structure cut disc structure length 254.3 mm radius of deflecting cells 69.12 mm (1st cell and 5th cell) 70.31 mm (2nd cell and 4th cell) 69.93 mm (3rd cell) thickness of deflecting cells radius of coupling cells thickness of coupling cells thickness of coupling cells beam hole diameter 20 mm	peak magnetic flux	16.09 mT (1st cell and 5th cell)
loaded Q 8841 external Q 14730 unloaded Q 22100 coupling factor 1.5 structure cut disc structure length 254.3 mm radius of deflecting cells 69.12 mm (1st cell and 5th cell) 70.31 mm (2nd cell and 4th cell) 69.93 mm (3rd cell) thickness of deflecting cells radius of coupling cells thickness of coupling cells thickness of coupling cells thickness of coupling cells beam hole diameter 20 mm	density on axis	13.53 mT (2nd cell and 4th cell)
loaded Q 8841 external Q 14730 unloaded Q 22100 coupling factor 1.5 structure cut disc structure length 254.3 mm radius of deflecting cells 69.12 mm (1st cell and 5th cell) 70.31 mm (2nd cell and 4th cell) 69.93 mm (3rd cell) thickness of deflecting cells radius of coupling cells thickness of coupling cells thickness of coupling cells beam hole diameter 20 mm		12.39 mT (3rd cell)
external Q 14730 unloaded Q 22100 coupling factor 1.5 structure cut disc structure length 254.3 mm radius of deflecting cells 70.31 mm (1st cell and 5th cell) 70.31 mm (2nd cell and 4th cell) 69.93 mm (3rd cell) thickness of deflecting cells radius of coupling cells thickness of coupling cells thickness of coupling cells beam hole diameter 20 mm		(if input power is 80 kW)
unloaded Q coupling factor structure length radius of deflecting cells thickness of deflecting cells thickness of thickness of coupling cells thickness of thickness of coupling cells thickness of thickness of coupling cells	loaded Q	8841
coupling factor structure length radius of deflecting cells thickness of deflecting cells radius of coupling cells thickness of thickness of coupling cells thickness of thickness of coupling cells	external Q	14730
structure length radius of deflecting cells thickness of deflecting cells radius of coupling cells thickness of coupling cells beam hole diameter 20 mm	unloaded Q	22100
length radius of deflecting cells for thickness of deflecting cells radius of coupling cells thickness of deflecting cells radius of coupling cells thickness of coupling cells thickness of coupling cells thickness of coupling cells thickness of coupling cells beam hole diameter 20 mm	coupling factor	1.5
radius of deflecting cells for thickness of deflecting cells radius of coupling cells thickness of deflecting cells radius of coupling cells thickness of coupling cells thickness of coupling cells thickness of coupling cells beam hole diameter deflecting (9.12 mm (1st cell and 5th cell) (70.31 mm (2nd cell and 4th cell) (49.93 mm (3rd cell) 44.3 mm 73.78 mm 20 mm	structure	cut disc structure
cells 70.31 mm (2nd cell and 4th cell) 69.93 mm (3rd cell) thickness of deflecting cells radius of coupling cells thickness of coupling cells beam hole diameter 20 mm	length	254.3 mm
thickness of deflecting cells radius of coupling cells thickness of thickness of coupling cells thickness of coupling cells beam hole diameter 20 mm	radius of deflecting	69.12 mm (1st cell and 5th cell)
thickness of deflecting cells radius of coupling cells thickness of coupling cells beam hole diameter 20 mm	cells	70.31 mm (2nd cell and 4th cell)
deflecting cells radius of coupling cells thickness of coupling cells beam hole diameter 20 mm		69.93 mm (3rd cell)
radius of coupling cells thickness of coupling cells beam hole diameter 20 mm	thickness of	44.3 mm
cells thickness of 4 mm coupling cells beam hole diameter 20 mm	deflecting cells	
cells thickness of 4 mm coupling cells beam hole diameter 20 mm	radius of coupling	73.78 mm
coupling cells beam hole diameter 20 mm		
beam hole diameter 20 mm	thickness of	4 mm
	coupling cells	
coupling hole size 983.2 mm ²	beam hole diameter	20 mm
	coupling hole size	983.2 mm ²

4. まとめと今後の予定

SuperKEKB計画に対応した、新しいフォトカソード RF電子銃の性能評価のため、バンチ長を測定するためのRFディフレクターを開発している。この RFディフレクターは S-band 帯の RFを使用する定在波管で、カットディスク構造を採用した。カットディスク構造ではセル間の結合を大きく取ることができるため、モードの切り分けが明確になるという利点がある。シミュレーションの結果から5セルの RFディフレクターを設計し、現在精密加工会社にて製作を依頼中である。RFディフレクターは9月末までに組立も含めて完成し、10月中旬までにインストールする予定である。実験は10月下旬から行う。

参考文献

- [1] T.Natsui *et al.*, "SuperKEKB 用 RF gun のコミッショニング状況" PASJ2015 WEP006, 第12回加速器学会年会, 青森, 2015 8 月.
- [2] Valentin V. Paramonov, "The Cut Disk Accelerating Structure For High Energy Linacs", Conference: Particle Accelerator Conference, 1997. Proceedings of the 1997, Volume: 3.
- [3] M.Yoshida, "電子線形加速器における高周波デバイスの 基礎 〜シミュレーション〜製作・試験", 高エネルギー加 速器セミナーOHO テキスト, 2008 年.